

Кластер ПХТ Al

Кластерная установка предназначена для проведения процессов плазмохимического травления (ICP RIE) слоев металлизации



Технологические характеристики:

- Размер обрабатываемых подложек $\varnothing 200$ мм;
- Количество одновременно загружаемых подложек – 1;
- Максимальная толщина травимого металла (Al), до 5 мкм;
- Селективность ФР/AL* – 1 : 2;
- Неравномерность травления:
по пластине – ± 5 %;
от пластины к пластине** – $\pm 2,5$ %;
от реактора к реактору** – ± 4 %.
- Скорость удаления фоторезиста при 270 °С,
до 3,5 мкм/мин;
- Диапазон рабочих давлений для модулей
Al 1-10 Па;
- Диапазон рабочих давлений для модулей
удаления ФР 200-400 Па.

